



金属、誘電体の薄膜形成に！

角型チャンバーに高真空排気系を有し、内部に10kwの電子銃と6個の切り替え式（手動）ルツボがあります。成膜プロセスは蒸着制御器により半自動運転を行います。

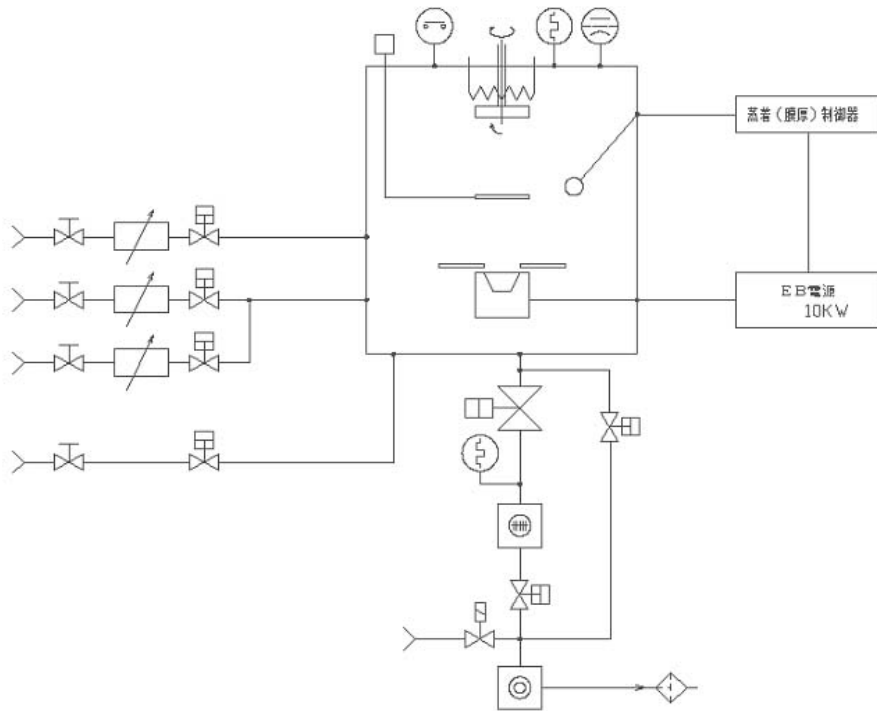
特長

1. 基板の加熱、蒸着角度の調整が可能な回転基板ホルダーで均一な成膜が可能。

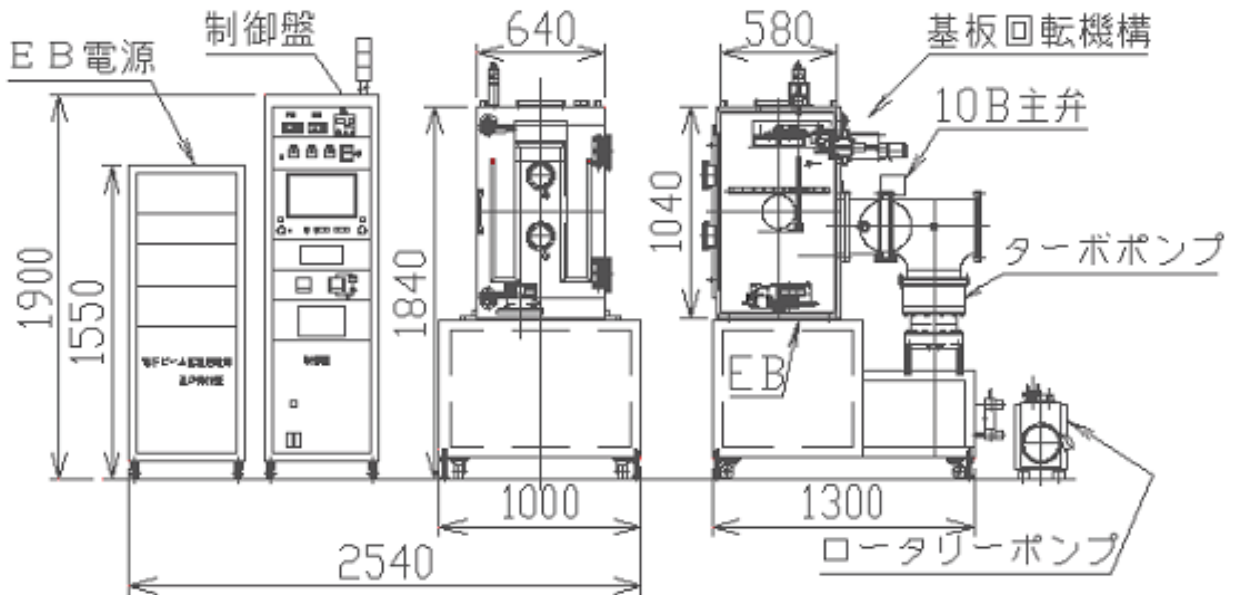
仕様

基板サイズ	127 mm × 127 mm × 0.3 ~ 1.0t 1枚
成膜速度	~250nm / min / AL (設計値)
基板加熱温度	RT ~ 400°C
膜厚分布	± 5% 以内
蒸着源	10kW
ガス系	3系 MFC 付き
真空排気系	ターボ分子ポンプ : 2300L/sec + ロータリーポンプ : 800L/min
真空到達時間	X10 ⁻⁴ Pa まで 15 分以内
その他の機構	基板回転機構 (0 ~ 20rpm) 基板角度手動調整 (0 ~ 90°)
お問合せ番号	05 D 001

装置フローシート



装置外観図



CryoVac

〒555-0013

大阪市西淀川区千舟2丁目12番14号

TEL : 06-6475-5266(代)

FAX : 06-6475-7330

URL : <http://www.cryovac.jp>

株式会社 **クライオバック**